

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0217U000513

Державний реєстраційний номер: 0115U003166

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-02-2017

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Розробка та виготовлення експериментального імпульсного ВЧ генератора

Початок етапу: 01.2016

Закінчення етапу: 12.2016

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14096245

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 057 7054668

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки

Код за ЄДРПОУ: 37536162

Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 406-82-00, 406-83-80

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 157.859
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка та дослідження характеристик імпульсного високочастотного генератора для стимуляції іонно-плазмового осадження покриттів

Назва роботи англійською:

Research and development of pulsed high-frequency generator for stimulate deposition ion-plasma coatings

Реферат українською:

Здійснено розробку, виготовлення і налагодження імпульсного високочастотного генератора потужністю в імпульсі 12,5 кВт для здійснення ВЧ стимуляції процесу формування наноструктурованих покриттів методом вакуумно-дугового осадження в експериментальних установках типу «Булат».

Реферат англійською:

Done development, manufacturing and commissioning of high-frequency pulse generator with a capacity of 12.5 kW pulse RF stimulation to make the process of formation of nanostructured coatings by vacuum arc deposition in experimental settings, such as “Bulat”.

Індекс УДК: 621.3, 537.534.7

Коди тематичних рубрик: 45.01.05

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Фаренік Володимир Іванович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Імпульсний ВЧ генератор для стимулювання процесів формування наноструктурованих покриттів

Назва НТП англійською: Pulsed RF generator to stimulate the processes of formation of nanostructured coatings

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: Електроніка

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Високоєфективне джерело імпульсної високочастотної напруги для керування іонними процесами формування наноструктурованих елементів.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 3 роки

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Приладобудівні підприємства

Перспективні ринки: Україна Країни Європейського Союзу

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 900

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 2000

Очікуваний термін окупності (років): 2

Додаткова інформація: спільне виробництво

IX. Бібліографічний опис

1. Lisovskiy V.A., Artushenko K.P., Yegorenkov V.D. Child–Langmuir law applicability for a cathode sheath description of glow discharge in hydrogen // Physica Scripta. – 2016. – Vol. 91, No. 8. – P. 085601(9pp). 2. S. Yakovin, A. Zykov, S. Dudin, V. Farenik, A. Goncharov, I. Shelest, V. Kuznetsov. Plasma assisted deposition of TaB₂ coatings by magnetron sputtering system // Book of abstracts. International Conference–School on Plasma Physics and Controlled Fusion. – Kharkiv, Ukraine, September 12–15, 2016. – P. 150.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Фаренік Володимир Іванович

к. ф.-м. н.

Перелік осіб-виконавців

Бурштинська Лідія Валентинівна

Казачкова Наталія Олександрівна

Кропотов Олександр Юрійович

Максименко Володимир Олексійович

Молотко Роман В'ячеславович

Турбін Петро Васильович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

